

光刻胶LR603-050 金属剥离胶

产品名称	光刻胶LR603-050 金属剥离胶
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

品供应：

产品	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用范围
厚胶 Thick Resist	SU-8 GM10xx系列	g/h/i-Line	负性	0.1um	0.1-200	具有较大的高宽比，透明度高
	SU-8 Microchem	g/h/i-Line	负性	0.5um	0.5-650	具有较大的高宽比，透明度高
	SPR220	g/h/i-Line	正性	1um	1—30	可用于选择性电镀电镀，深硅
电子束光刻胶	NR26-25000P	g/h/i-Line	负性		20-130	厚度大，相对容易去胶。
	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用范围
	SU-8 GM1010	电子束	负性	100nm	0.1-0.2	可用于做高宽比较大的纳米结
	HSQ	电子束	负性	6nm	30nm~180	分辨率较好的光刻胶，抗刻蚀
	XR-1541-002/004/006				nm	
	HSQ Fox-15/16	电子束	负性	100nm	350nm~81	分辨率较好的光刻胶，抗刻蚀
					0nm	
	PMMA(国产)	电子束	正性	\	\	高分辨率，适用于电子束光刻
	PMMA ()	电子束	正性	\	\	用的电子束光刻正胶。
薄胶	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用范围
	S18xx系列	g-Line	正性	0.5um	0.4-3.5	较常用的薄光刻胶，分辨率高
	SPR955系列	i-Line	正性	0.35um	0.7-1.6	高分辨率 (0.35um) 光刻胶，
	BCI-3511	i-Line	正性	0.35um	0.5-2	国产0.35um光刻胶，已经在量
						使用。

	NRD6015	248nm	负性	0.2um	0.7-1.3	国产深紫外光刻胶，已经在量使用。
Lift off光刻胶	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (μ m)	适用范围
	KXN5735-LO	g/h/i-Line	负性	4 μ m	2.2-5.2	负性光刻胶;倒角65-80 ° ，使用显影液显影。
	LOL2000/3000	g/h/i-Line	/	NA	130nm-300nm	非感光性树脂，可以被显影液ift off双层胶工艺中底层胶使用。
	ROL-7133	g/h/i-Line	/	4um	2.8-4	负性光刻胶，倒角75~80 ° ，使用显影液。
光刻胶配套试剂	品名	主要成分	包装	应用	/	/
	正胶显影液	TMAH 2.38%	4LR/PC	正胶显影液	/	/
	正胶稀释剂	PGMEA	4LR/PC	稀释剂	/	/
	SU8 显影液	PGMEA	4L/PC	显影SU8光刻胶	/	/
	RD-HMDS	HMDS	500ml/PC	增粘剂	/	/
	OMNICOAT	见MSDS	500ml/PC	SU-8增粘剂		